



265 Industrial Way West, Ste. 7
Eatontown, NJ 07724-2213
Tel: (732) 982-8222 • Fax: (732) 982-8223
www.hapmarketing.com

NEWS RELEASE

Client: Gelest

Media contact: Mike Rubin
732-982-8238
mike.rubin@hapmarketing.com

For Immediate Release

GELEST, INC. COMMERCIALIZES DIIDOSILANE TO MEET GLOBAL DEMAND FOR NEXT-GENERATION SEMICONDUCTORS

MORRISVILLE, Pa. (June 26, 2018) – Gelest, Inc. announced today it has commercialized diiodosilane to meet the global demand of the semiconductor industry for next-generation semiconductor chips. Gelest’s dedicated diiodosilane plant in Morrisville, Pa., is fully operational and can produce commercial quantities of diiodosilane with purity in excess of 99.9%.

Diiodosilane is a key chemical precursor used by semiconductor companies worldwide in the development and scale-up of next-generation semiconductor chips that require high throughput, highly conformal silicon nitride thin films. Diiodosilane is typically deposited by plasma-enhanced atomic layer deposition (PEALD) to create the silicon nitride thin film. Gelest sees a significant increase in demand for high purity diiodosilane driven by development and production of semiconductor chips requiring silicon nitride thin films at low thermal budgets.

“Diiodosilane is a critical material that enables further miniaturization of semiconductor chips,” said Dr. Jeffrey T. DePinto, Business Manager Silanes & Metal Organics. “Our expertise in high purity silicon precursors for the semiconductor industry has allowed us

to optimize the synthesis and scale-up of diiodosilane with the highest possible purity and lowest cost.”

Furthermore, Gelest has been developing iodasilane precursors for silicon nitride thin films for many years. The company has been granted a key patent, “Silicon-based Films Formed From Iodosilane Precursors and Method of Making the Same,” that claims a method for depositing silicon nitride thin films using iodasilane precursors.

About Gelest

Gelest, Inc., headquartered in Morrisville, Pennsylvania, has been a leading manufacturer and independent producer of specialty materials for the semiconductor industry for more than 25 years. Gelest is recognized worldwide as an innovator, manufacturer and supplier of commercial and research quantities of organosilicon compounds, metal-organic compounds and silicones. The company serves advanced technology markets through a materials science-driven approach. It provides focused technical development and application support for semiconductors, medical materials, pharmaceutical synthesis, diagnostics and separation science, and specialty polymeric materials: “Gelest – Enabling Your Technology.” – www.gelest.com

#

Gelest, Inc.
Enabling your Technology

Manufacturers of Silanes, Silicones & Metal-Organics
11 E. Steel Road, Morrisville, Pennsylvania 19067
Tel: 215-547-1015 Fax: 215-547-2484



265 Industrial Way West, Ste. 7
Eatontown, NJ 07724-2213
Tel: (732) 982-8222 • Fax: (732) 982-8223
www.hapmarketing.com

NEWS RELEASE

고객: Gelest

미디어 담당 연락처: 마이크 루빈(Mike Rubin)
732-982-8238
mike.rubin@hapmarketing.com

즉시 배포용 자료

Gelest, INC.는 차세대 반도체용 글로벌 수요 충족을 위한 디요오도실란의 상업화에 성공

모리스빌, 펜실바니아주 (2018년 6월 26일) – 오늘 Gelest, Inc.는 차세대 반도체 칩 제조를 위한 반도체 업계의 글로벌 수요 충족을 위해 디요오도실란을 상업화 하였다고 발표하였다. 펜실바니아주 모리스빌에 위치한 Gelest의 디요오도실란 전용 공장은 완전 가동 상태이며 99.9% 이상 순도의 디요오도실란을 상업적 물량으로 생산할 수 있다.

디요오도실란은 고 생산성과 고 점착성의 실리콘 나이트라이드 박막이 요구되는 차세대 반도체 칩의 개발과 증산을 위해 전 세계 반도체 회사가 사용하는 아주 중요한 화학적 전구물질이다. 디요오도실란은 일반적으로 실리콘 나이트라이드 박막 형성을 위해 플라즈마 강화 원자층 증착(PEALD) 방식으로 증착된다. Gelest는 낮은 열처리량의 실리콘 나이트라이드 박막이 요구되는 반도체 칩의 개발 및 생산을 위해 필요한 고순도 디요오도실란에 대한 현저한 수요 증가를 예견하고 있다.

Silane & Metal Organics 담당 사업 매니저인 Dr. Jeffrey T. DePinto는 "디요오도실란은 반도체 칩을 더욱 소형화할 수 있도록 하는 아주 중요한 소재입니다"라고 말하였다.

"반도체 업계에서 사용되는 고순도 실리콘 전구물질에 대한 저희의 전문 기술을 통해

저희는 가능한 최고 순도와 가장 낮은 비용으로 디요오도실란의 합성과 생산 확대를 최적화 할 수 있었습니다."

또한, Gelest 는 수 년간 실리콘 나이트라이드 박막용 요오도실란 전구물질을 개발해왔다. 이 회사는 요오도실란 전구물질을 사용한 실리콘 나이트라이드 증착 방법을 포함하는 "Silicon-based Films Formed From Iodosilane Precursors and Method of Making the Same"이라는 주요 특허권도 보유하고 있다.

Gelest 회사 소개

펜실바니아주 모리스빌에 본사를 둔 Gelest, Inc.는 지난 25 년 이상 동안 반도체 업계용 특수 재료의 선도적 독립 제조사이다. 전 세계적으로 Gelest 는 유기 규소 화합물, 금속 유기 화합물 및 실리콘에 대한 혁신적인 회사이며 이들 물질을 상업적 및 연구 개발 물량으로 생산하고 제공하는 회사로서 인정을 받고 있다. 이 회사는 재료 과학을 주요 기반으로 첨단 기술 시장의 요구에 부응하고 있다. 이 회사는 또한 반도체, 의료 재료, 의약품 합성, 진단 및 분리 과학 그리고 특수 중합체 재료 분야에 대한 집중 기술 개발 및 응용 지원 서비스를 제공하고 있다.

“Gelest – Enabling Your Technology.” – www.gelest.com

#

귀사의 기술을 실현하는
Gelest, Inc.

실란 및 금속-유기물 제조사

11 E. Steel Road, Morrisville, Pennsylvania 19067
전화번호: 215-547-1015 팩스: 215-547-2484



265 Industrial Way West, Ste. 7
Eatontown, NJ 07724-2213
Tel: (732) 982-8222 • Fax: (732) 982-8223
www.hapmarketing.com

NEWS RELEASE

客戶: Gelest

媒體聯絡人: Mike Rubin
732-982-8238
mike.rubin@hapmarketing.com

即時發布

GELEST, INC. 將二碘硅烷商業化 以便滿足下一代半導體行業的全球需求

賓夕法尼亞州莫里斯維爾市（2018年6月26日）— Gelest, Inc. 今天宣布，已將二碘硅烷商業化，以便滿足半導體行業對於下一代半導體晶片的全球需求。Gelest 位於賓夕法尼亞州莫里斯維爾市的專用二碘硅烷工廠已全面投入運營，並且可以生產滿足商業數量的純度超過 99.9% 的二碘硅烷。

二碘硅烷是全球半導體公司在開發和擴大需要高產量、高度保形的氮化硅薄膜的下一代半導體晶片所使用的關鍵化學產品。二碘硅烷通常會透過等離子體增強型原子層沉積 (PEALD) 來進行沉積，以形成氮化硅薄膜。Gelest 認為，由於在低熱預算下開發和生產需要氮化硅薄膜的半導體晶片，因此對高純度二碘硅烷的需求量大幅增加。

硅烷和金屬有機物業務經理 Jeffrey T. DePinto 博士說：「二碘硅烷是使半導體晶片能夠進一步微型化的關鍵材料。」「我們在半導體行業的高純度硅前體方面的專業知識，使我們能夠可以最低成本生產最高純度二碘硅烷。」

此外，Gelest 多年來一直在開發用於氮化硅薄膜的碘硅烷。該公司已被授予一項關鍵專利，即「由碘硅烷前體形成的硅基薄膜及其製造方法」，該專利聲明了使用碘硅烷前體來沉積氮化硅薄膜的方法。

關於 Gelest

Gelest, Inc. 的總部位於賓夕法尼亞州莫里斯維爾市，25 年多以來一直是一家領先的半導體行業特種材料的製造商和獨立生產商。Gelest 是全球公認的滿足商業和研發的有機硅化合物、金屬有機化合物和聚硅氧烷的創新者、製造商和供應商。該公司透過材料科學驅動的方法為先進技術市場提供服務。其為半導體、醫療材料、藥物合成、診斷和分離科學以及特種聚合物材料提供了重點技術開發和應用支持：「Gelest—實現您的技術」。 —

www.gelest.com

#

Gelest, Inc.
實現您的技術

硅烷、聚硅氧烷和金屬有機物的製造商
11 E. Steel Road, Morrisville, Pennsylvania 19067
電話：215-547-1015 傳真：215-547-2484